28. 7. 2004

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

REC'D 1 9 AUG 2004
WIPO PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年 7月28日

出 願 番 号 Application Number:

人

特願2003-280625

[ST. 10/C]:

[JP2003-280625]

出 願
Applicant(s):

日産化学工業株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 7月 8日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





【書類名】 特許願 【數理悉号】 455300

【整理番号】 4553000 【提出日】 平成15年

【提出日】平成15年 7月28日【あて先】特許庁長官殿【国際特許分類】G03F 7/033

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県船橋市坪井町722番地1 日産化学工業株式会社 電子

【氏名】 【発明者】

【住所又は居所】 千葉県船橋市坪井町722番地1 日産化学工業株式会社 電子

材料研究所内 飯沼 洋介

【氏名】

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県船橋市坪井町722番地1 日産化学工業株式会社 電子

材料研究所内 荒瀬 慎哉

【氏名】 【特許出願人】

【識別番号】 000003986

【氏名又は名称】 日産化学工業株式会社

【代表者】 藤本 修一郎 【電話番号】 047-465-1120

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 005212 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

 【物件名】
 明細書 1

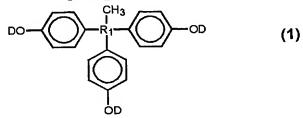
 【物件名】
 要約書 1

### 【書類名】特許請求の範囲

### 【請求項1】

不飽和カルボン酸誘導体とN-置換マレイミドとを必須とする共重合体であり、数平均分子量が2,000~20,000のアルカリ可溶性樹脂と、一般式(1)

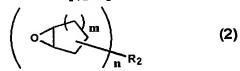
#### 【化1】



(式中、Dはそれぞれ独立に水素原子または1, 2-キノンジアジド基を有する有機基であり、 $R_1$  は4 価の有機基である。ただし、Dの少なくとも1 つは、1, 2-キノンジアジド基を有する有機基である。)

で示される 1 , 2- キノンジアジド化合物と、アルカリ可溶性樹脂に対して 5- 5 0 重量 部の一般式( 2 )

### 【化2】



(式中、nは2~10の整数、mは0~4の整数を示し、R2はn価の有機基を表す)で表される架橋性化合物とを含有することを特徴とするポジ型感光性樹脂組成物。

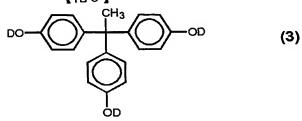
### 【請求項2】

アルカリ可溶性樹脂の残留モノマー率が2.5重量%以下であることを特徴とする、請求項1に記載のポジ型感光性樹脂組成物。

#### 【請求項3】

1, 2-キノンジアジド化合物が下記式(3)

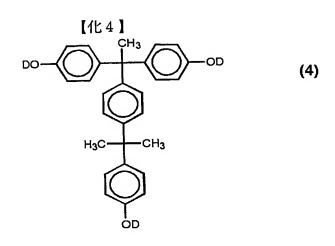
### 【化3】



(式中、Dはそれぞれ独立に水素原子または1,2-キノンジアジド基を有する有機基であり、Dの少なくとも1つは、1,2-キノンジアジド基を有する有機基である。)で示される化合物であることを特徴とする、請求項1または請求項2に記載のポジ型感光性樹脂組成物。

# 【請求項4】

1,2-キノンジアジド化合物が下記式(4)



(式中、Dはそれぞれ独立に水素原子または1,2ーキノンジアジド基を有する有機基であり、Dの少なくとも1つは、1,2ーキノンジアジド基を有する有機基である。) で示される化合物であることを特徴とする、請求項1または請求項2に記載のポジ型感光性樹脂組成物。

# 【請求項5】

アルカリ可溶性樹脂がエポキシ基を有さないことを特徴とする、請求項1または請求項2に記載のポジ型感光性樹脂組成物。

### 【書類名】明細書

【発明の名称】ポジ型感光性樹脂組成物

# 【技術分野】

# [0001]

本発明はポジ型感光性樹脂組成物に関する。さらに詳しくはディスプレイ材料用途として好適なポジ型感光性樹脂組成物に関する。

# 【背景技術】

# [0002]

一般に、薄膜トランジスタ(TFT)型液晶表示素子、有機EL素子等のディスプレイ素子においてはパターン形成された電極保護膜、平坦化膜、絶縁膜等が設けられている。これらの膜を形成する材料としては、必要とするパターン形状を得るための工程数が少なく、しかも十分な平坦性を有するという特徴を持つ、感光性樹脂組成物が幅広く使用されている。そして、これらの膜には、耐熱性、耐溶剤性、長時間焼成耐性などのプロセス耐性、高透明性、下地との密着性等の諸特性が要求されている。

### [0003]

したがって、これらの膜を形成する感光性樹脂組成物としては、上記諸特性に優れた硬化物を与え得ることが必要である。また、これに加えて感光性樹脂組成物の保存安定性のよいこと、使用目的に合わせた様々なプロセス条件でパターンを形成し得る広いプロセスマージンを有することも望まれている。さらには、解像度、感度等の感光特性も重要となる。一方、液晶表示素子用途においては、例えば液晶を汚染しないといった信頼性の高い材料も必要不可欠である。

# [0004]

このように、ディスプレイ材料用途における感光性樹脂組成物には、様々な特性が必要となる。これに対し、感光性樹脂組成物の個々の特性に関しては、これまでも様々な検討がなされてきた。例えば、高耐熱性・高透明性を両立させるものとして、アルカリ可溶性樹脂中にグリシジル基を有する材料が報告されている(例えば、特許文献1参照)。一方、高感度・高解像度を実現するものとして、1,2ーナフトキノンジアジド化合物を用いた材料が報告されている(例えば、特許文献2参照。)。

#### [0005]

しかしながら、上記の種々の諸特性を全て満足できる感光性樹脂組成物を開発することは必ずしも容易ではなく、従来技術の単なる組み合わせでは困難であった。また、液晶表示素子用途として、電気特性を悪化させない信頼性の高い材料は、これまでに報告例がない。

【特許文献1】特開平8-262709号公報

【特許文献2】特開平4-211255号公報

### 【発明の開示】

### 【発明が解決しようとする課題】

#### [0006]

本発明の目的は、耐熱性、耐溶剤性、長時間焼成耐性等のプロセス耐性、および透明性に優れる硬化膜を作製することができ、かつ、解像度、感度等の感光特性に優れ、保存安定性が高くプロセスマージンの広いポジ型感光性樹脂組成物、さらには液晶表示素子用途として、電気特性の悪化を招くことのない信頼性の高いポジ型感光性樹脂組成物を提供することにある。

# 【課題を解決するための手段】

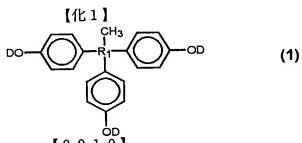
#### [0007]

本発明の課題は、以下に示すポジ型感光性樹脂組成物によって達成される。

#### [0008]

1. 不飽和カルボン酸誘導体とN-置換マレイミドとを必須とする共重合体であり、数平均分子量が2, 000~20, 000のアルカリ可溶性樹脂と、一般式(1)

### [0009]



[0010]

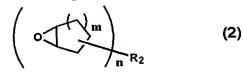
(式中、Dはそれぞれ独立に水素原子または1, 2-キノンジアジド基を有する有機基であり、 $R_1$  は4 価の有機基である。ただし、Dの少なくとも1つは、1, 2-キノンジアジド基を有する有機基である。)

### [0011]

で示される1,2ーキノンジアジド化合物と、アルカリ可溶性樹脂に対して5~50重量 部の一般式(2)

[0012]

【化2】



[0013]

(式中、nは2~10の整数、mは0~4の整数を示し、R2はn価の有機基を表す)

[0014]

で表される架橋性化合物とを含有することを特徴とするポジ型感光性樹脂組成物。

# [0015]

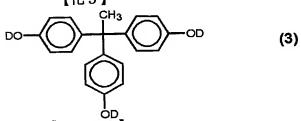
2. アルカリ可溶性樹脂の残留モノマー率が2.5重量%以下であることを特徴とする、1に記載のポジ型感光性樹脂組成物。

### [0016]

3. 1, 2-キノンジアジド化合物が下記式(3)

[0017]

【化3】



【0018】 (式中、Dはそれぞれ独立に水素原子または1,2-キノンジアジド基を有する有機基であり、Dの少なくとも1つは、1,2-キノンジアジド基を有する有機基である。)

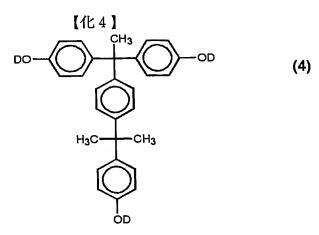
[0019]

で示される化合物であることを特徴とする、上記1または2に記載のポジ型感光性樹脂組成物。

[0020]

4. 1, 2-キノンジアジド化合物が下記式(4)

[0021]



### [0022]

(式中、Dはそれぞれ独立に水素原子または1,2ーキノンジアジド基を有する有機基であり、Dの少なくとも1つは、1,2ーキノンジアジド基を有する有機基である。)

### [0023]

で示される化合物であることを特徴とする、上記1または2に記載のポジ型感光性樹脂組成物。

### [0024]

5. アルカリ可溶性樹脂がエポキシ基を有さないことを特徴とする、上記1または2 に記載のポジ型感光性樹脂組成物。

#### 【発明の効果】

#### [0025]

本発明によって、耐熱性、耐溶剤性、長時間焼成耐性等のプロセス耐性、および透明性に優れる硬化膜を作製することができ、かつ、解像度、感度等の感光特性に優れ、保存安定性が高くプロセスマージンの広いポジ型感光性樹脂組成物、さらには液晶表示素子用途として、電気特性の悪化を招くことのない信頼性の高いポジ型感光性樹脂組成物を得ることができる。

# 【発明を実施するための最良の形態】

#### [0026]

以下、本発明の感光性樹脂組成物について具体的に説明する。

#### [0027]

### <アルカリ可溶性樹脂>

本発明のポジ型感光性樹脂組成物に含有されるアルカリ可溶性樹脂は、不飽和カルボン酸誘導体とN-置換マレイミドとを必須成分とする共重合体(以下、特定共重合体と表記する)であり、その数平均分子量は2,000~20,000である。

#### [0028]

この特定共重合体を構成する不飽和カルボン酸誘導体は特に限定されないが、具体例としてはメタクリル酸、メタクリル酸メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、ローブチルメタクリレート、secーブチルメタクリレート、エーブチルメタクリレートなどのメタクリル酸アルキルエステル類、アクリル酸、メチルアクリレート、イソプロピルアクリレートなどのアクリル酸アルキルエステル類、シクロヘキシルメタクリレート、ジシクロペンタニルオキシエチルメタクリレート、ジシクロペンタニルオキシエチルメタクリレートなどのメタクリル酸環状アルキルエステル類、シクロヘキシルアクリレート、ジシクロペンタニルオキシエチルアクリレート、イソボロニルアクリレートなどのアクリル酸環状アルキルエステル類、フェニルメタクリレート、ベンジルメタクリレートなどのアクリル酸アリールエステル類;フェニルアクリレート、ベンジルアクリレートなどのアクリル酸アリールエステル類;フェニルアクリレート、ベンジルアクリレートなどのアクリル酸アリールエステル類;フェニルアクリレート、ベンジルアクリレートなどのアクリル酸アリールエステル類;マレイン酸ジエチル、フマル酸ジエチル、イタコン酸ジエチルなどのジカルボン酸ジエステル;2ーヒドロキシエチルメタクリレート、2ーヒドロキシプロピルメタクリレ

ート、2ーヒドロキシエチルメタクリレート、などのヒドロキシアルキルエステル類; ビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン、5ーメチルビシクロ[2.2.1] ヘプトー 2-エン、5-エチルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン、5-ヒドロキシビシク ロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーエン、5ーカルボキシビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2 ーエン、5ーヒドロキシメチルビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン、5ー(2'ー ヒドロキシエチル) ビシクロ [2.2.1] ヘプト-2-エン、5-メトキシビシクロ[ 2. 2. 1] ヘプトー2ーエン、5ーエトキシビシクロ[2. 2. 1] ヘプトー2ーエン 、 5 , 6 - ジヒドロキシビシクロ [2 . 2 . 1 ] ヘプト- 2 - エン、 5 , 6 - ジカルボキ シビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン、5,6ージ(ヒドロキシメチル)ビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-2-エン、5,6-ジ(2'-ヒドロキシエチル) ビシクロ[2 . 2. 1] ヘプト-2-エン、5, 6-ジメトキシビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン、5,6-ジエトキシビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン、5-ヒドロキシー 5-メチルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン、5-ヒドロキシ-5-エチルビシ クロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン、5ーカルボキシー5ーメチルビシクロ[2.2. 1] ヘプト-2-エン、5-カルボキシ-5-エチルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2 ーエン、5ーヒドロキシメチルー5ーメチルビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン、 5-カルボキシー6-メチルビシクロ[2.2.1] ヘプトー2-エン、5ーカルボキシ -6-エチルビシクロ[2.2.1] ヘプトー2-エン、5,6-ジカルボキシビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーエン無水物(ハイミック酸無水物)、5ーtーブトキシカル ボニルビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン、5ーシクロヘキシルオキシカルボニル ビシクロ [2.2.1] ヘプト-2-エン、5-フェノキシカルボニルビシクロ [2.2 . 1] ヘプト-2-エン、5, 6-ジ(t-ブトキシカルボニル) ビシクロ[2.2.1 ] ヘプト-2-エン、5,6-ジ(シクロヘキシルオキシカルボニル)ビシクロ[2.2 . 1] ヘプトー2ーエン等のビシクロ不飽和化合物類などが挙げられる。これらの不飽和 カルボン酸誘導体は単独でも2種以上で併用してもよい。

#### [0029]

特定共重合体における不飽和カルボン酸誘導体の比率は、好ましくは10~99重量% 、より好ましくは30~95重量%、最も好ましくは50~80重量%である。不飽和カルボン酸誘導体が10重量%未満の場合には、共重合体のアルカリ溶解性が不足する。

# [0030]

特定共重合体を構成するNー置換マレイミドは特に限定されないが、具体例としてはシクロヘキシルマレイミド、フェニルマレイミド、メチルマレイミド、エチルマレイミドなどが挙げられる。透明性の観点から芳香環を有さない物が好ましく、現像性、透明性、耐熱性の点から脂環骨格を有するものがより好ましく、中でもシクロヘキシルマレイミドが最も好ましい。

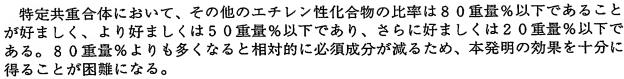
### [0031]

特定共重合体におけるNー置換マレイミドの比率は、好ましくは $1\sim70$  重量%、より好ましくは $5\sim50$  重量%、最も好ましいのは $20\sim40$  重量%である。Nー置換マレイミドが10 重量%未満の場合は共重合体のTgが低くなり、耐熱性に劣る場合がある。70 重量%以上の場合には、透明性が低下する場合がある。

#### [0032]

特定共重合体を構成する成分は、不飽和カルボン酸誘導体、N-置換マレイミドを必須とし、さらに、共重合可能なその他のエチレン性化合物を加えても良い。このようなエチレン性化合物の具体例としては、スチレン、 $\alpha-$ メチルスチレン、m-メチルスチレン、p-メチルスチレン、ビニルトルエン、p-メトキシスチレン、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、塩化ビニル、塩化ビニリデン、アクリルアミド、メタクリルアミド、酢酸ビニル、1, 3-ブタジエン、イソプレン、2, 3-ジメチル-1, 3-ブタジエン、などが挙げられる。これらのエチレン性化合物は、特定共重合体の溶解性、疎水性などの調整、および分子量を制御する目的で導入することができる。

#### [0033]



### [0034]

特定共重合体においては、共重合体同士が反応し得る官能基を有さないことが好ましく、特にエポキシ基を含まないことが好ましい。共重合体同士が反応し得る官能基を有する場合、組成物の溶液の粘度、および感度の保存安定性が低下する場合がある。

### [0035]

以上のように、特定共重合体を構成する各モノマーの最も好ましい比率の例は、不飽和 カルボン酸誘導体が50~80重量%、N-置換マレイミドが20~40重量%、その他 のエチレン性化合物が0~20重量%である。

#### [0036]

以上に挙げた特定共重合体を得る方法は特には限定されない。一般的には前記したモノマーを重合溶媒中でラジカル重合することにより製造される。また、必要に応じて、モノマーの官能基を保護した状態でこれらを重合し、その後、脱保護処理を行ってもよい。

### [0037]

特定共重合体を製造するために用いられる重合溶媒としては、例えばメタノール、エタ ノール、プロパノール、ブタノール等のアルコール類、テトラヒドロフラン、ジオキサン 等のエーテル類、ペンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類;N,N-ジメチ ルホルムアミド、N-メチルー2ーピロリドン等の極性溶媒、酢酸エチル、酢酸ブチル、 乳酸エチル等のエステル類、3-メトキシプロピオン酸メチル、2-メトキシプロピオン 酸メチル、3-メトキシプロピオン酸エチル、2-メトキシプロピオン酸エチル、3-エ トキシプロピオン酸エチル、2-エトキシプロピオン酸エチル等のアルコキシエステル類 、エチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエ チレングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコールメチルエチルエーテル、プロ ピレングリコールジメチルエーテル、ジプロピレングリコールジメチルエーテル等の(ジ ) グリコールジアルキルエステル類、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレン グリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレン グリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレン グリコールモノエチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピ レングリコールモノエチルエーテル等の (ジ) グリコールモノアルキルエーテル類、プロ ピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、カルビトールアセテート、エチルセロ ソルブアセテート等のグリコールモノアルキルエーテルエステル類、シクロヘキサノン、 メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、2-ヘプタノン等のケトン類を挙げるこ とができる。これらの重合溶媒は単独でも2種類以上を組み合わせて用いることもできる

#### [0038]

本発明のポジ型感光性樹脂組成物に含有されるアルカリ可溶性樹脂は、上記特定共重合体のうち、ポリスチレン換算数平均分子量で、2, 000~20, 000、好ましくは3, 000~1, 5000、より好ましくは3, 000~10, 000のものである。数平均分子量が1, 000以下の場合には、得られるパターンの形状が不良なものとなったり、パターンの残膜率が低下したり、パターンの耐熱性が低下したりする傾向が見られる。一方、数平均分子量が20, 000を超える場合には、感光性樹脂組成物の塗布性が不良なものとなったり、現像性が低下したり、また、得られるパターンの形状が不良なものとなったりする場合がある。また、数平均分子量が20, 000を超える場合には、 $50\mu$  m以下のパターン間に残膜が存在し解像度が低下する場合がある。

#### [0039]

また、本発明のポジ型感光性樹脂組成物に含有されるアルカリ可溶性樹脂は、残留モノマー率が低いものを用いることが好ましい。ここで示す残留モノマーとは、前記特定共重

合体を合成した後に残存する、特定共重合体を構成する各モノマー成分の未反応物のこと である。残留モノマー率は、合成反応に使用した共重合体構成モノマーの各成分全量に対 する各残留モノマー成分全量の比率を重量%で表したものである。残留モノマー率は、例 えば、反応液を液体クロマトグラフィーなど用いて分析することにより確認することがで きる。

# [0040]

好ましい残留モノマー率を具体的に示すならば、2.5重量%以下であり、2.0%重 量以下がより好ましく、1.5重量%以下が最も好ましい。残留モノマー率が2.5重量 %を超える場合には、表示素子の電気特性が低下する場合がある。

# [0041]

アルカリ可溶性樹脂中の残留モノマーを低減させる手法は特に限定されないが、例えば 、高分子有機合成において一般的に知られている再沈殿等の精製を行うか、もしくは重合 の最終段階で反応温度を上昇させることで得ることができる。

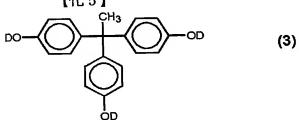
# [0042]

<1.2ーキノンジアジド化合物>

本発明のポジ型感光性樹脂組成物に含有される1,2-キノンジアジド化合物としては 、一般式 (1) で表されるものでれば、特に限定されないが、あえてその具体例を挙げる ならば、感度、解像度、透明性の観点から下式(3)または(4)で表される化合物が好 ましい

### [0043]

# 【化5】



[0044]

(式中、Dはそれぞれ独立に水素原子または1,2-キノンジアジド基を有する有機基で あり、Dの少なくとも1つは、1,2-キノンジアジド基を有する有機基である。)

### [0045]

### 【化6】

$$H_3C$$
  $CH_3$   $CH_3$ 

# [0046]

(式中、Dはそれぞれ独立に水素原子または1,2-キノンジアジド基を有する有機基で あり、Dの少なくとも1つは、1,2-キノンジアジド基を有する有機基である。)

#### [0047]

本発明のポジ型感光性樹脂組成物における、1,2ーキノンジアジド化合物の含有量は 、アルカリ可溶性樹脂成分100重量部に対して、好ましくは5~100重量部、より好 ましくは10~50重量部、最も好ましいのは10~30重量部である。

# [0048]

1,2ーキノンジアジド化合物の量が、アルカリ可溶性樹脂成分100重量部に対して5重量部未満であると、ポジ型感光性樹脂組成物の、露光部と未露光部の現像液溶解度差が小さくなって現像によるパターニングが困難になることがあり、一方100重量部を超えると、短時間の露光では1,2ーキノンジアジド化合物が充分に分解されず、感度が低下してしまうことがある。

### [0049]

### <架橋性化合物>

本発明のポジ型感光性樹脂組成物に含有される、架橋性化合物は一般式(2)で表されるものであれば特に限定されないが、その具体例としては、シクロヘキセンオキサイド構造を有するエポキシ樹脂であるエポリードGT-401、同GT-403、同GT-301、同GT-302、セロキサイド2021、セロキサイド3000(ダイセル化学(株)製)、脂環式エポキシ樹脂であるデナコールEX-252(ナガセケムッテクス(株)製)、CY175、CY177、CY179(以上、CIBA-GEIGY A. G製)、アラルダイトCY-182、同CY-192、同CY-184(以上、CIBA-GEIGY A. G製)、エピクロン200、同400(以上、大日本インキ工業(株)製)、エピコート871、同872(以上、油化シェルエポキシ(株)製)、ED-5661、ED-5662(以上、セラニーズコーティング(株)製)、等を挙げることができる。また、これらの架橋性化合物は、単独または2種類以上を組み合わせて用いることができる。

### [0050]

これらのうち、耐熱性、耐溶剤性、耐長時間焼成耐性等の耐プロセス性、および透明性の観点からシクロヘキセンオキサイド構造を有するエポキシ樹脂が好ましい。

# [0051]

上記架橋性化合物の含有量は、アルカリ可溶性樹脂成分100重量部に対して5~50重量部、好ましくは10~40重量部、より好ましいのは15~30重量部である。架橋性化合物の含有量が少ない場合には、系の架橋密度が不十分となるため、パターン形成後の耐熱性、耐溶剤性、耐長時間焼成耐性等の耐プロセス性が低下する。また、架橋性化合物の含有量を10重量部以上にした場合は、残留モノマー率が2.5重量%を超える場合でも、表示素子の電気特性を低下させない効果がある。一方、50重量部を超える場合には、未架橋の架橋性化合物が存在し、パターン形成後の耐熱性、耐溶剤性、耐長時間焼成耐性等の耐プロセス性が低下し、感光性樹脂組成物の保存安定性が悪くなる場合がある。

#### [0052]

以上のように、本発明のポジ型感光性樹脂組成物に含有される各成分の最も好ましい含有量の例は、アルカリ可溶性樹脂成分100重量部に対して、1,2-キノンジアジド化合物が10~30重量部、2個以上のエポキシ基を含有する架橋性化合物が15~30重量部、である。

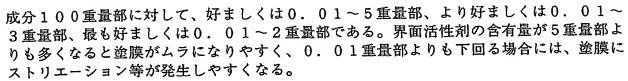
### [0053]

#### <その他含有しても良い成分>

本発明のポジ型感光性樹脂組成物は、塗布性を向上させる目的で、界面活性剤を含んでいることは勿論好ましい。このような界面活性剤は、フッ素系界面活性剤、シリコーン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤など特に限定されないが、塗布性改善効果の高さからフッ素系界面活性剤が好ましい。フッ素系界面活性剤の具体例としては、エフトップEF301、EF303、EF352((株)トーケムプロダクツ製)、メガファックF171、F173、R-30(大日本インキ(株)製)、フロラードFC430、FC431(住友スリーエム(株)製)、アサヒガードAG710、サーフロンS-382、SC101、SC102、SC103、SC104、SC105、SC106(旭硝子(株)製)等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

### [0054]

本発明のポジ型感光性樹脂組成物における界面活性剤の含有量は、アルカリ可溶性樹脂



### [0055]

本発明のポジ型感光性樹脂組成物は、現像後の基板との密着性を向上させる目的で、密着促進剤を含んでいることは勿論好ましい。このような密着促進剤の具体例としては、トリメチルクロロシラン、ジメチルビニルクロロシラン、メチルジフエニルクロロシラン、メチルジフエニルクロロシラン、メチルジストキシシラン、ジメチルビニルクロロシラン類、トリメチルメトキシシラン、ジスチルジストキシシラン、フエニルトリエトキシシラン等のアルコキシシラン類、ヘキサメチルジシラザン、N,N'ービス(トリメチルシリル)ウレア、ジメチルトリメチルシリルアミン、トリメチルシリルイミダゾール等のシラザン類、ビニルトリクロロシラン、アークロロプロピルトリメトキシシラン、アーアミノプロピルトリエトキシシラン、アーメタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、アーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン等のシラン類、ベンゾトリアゾール、ベンズイミダゾール、インダゾール、イミダゾール、2ーメルカプトベンブオキサゾール、ウラゾール、チオウラシル、メルカプトイミダゾール、メルカプトビリミジン等の複素環状化合物や、1、1ージメチルウレア、1、3ージメチルウレア等の尿素、またはチオ尿素化合物を挙げることができる。

#### [0056]

これらの密着促進剤の使用割合は、アルカリ可溶性樹脂成分100重量部に対して、通常、20重量部以下、好ましくは $0.05\sim10$ 重量部、特に好ましくは $1\sim10$ 重量部である。

#### [0057]

本発明のポジ型感光性樹脂組成物は、その他、必要に応じて顔料、染料、保存安定剤、消泡剤などを含んでいてもよい。

### [0058]

#### <ポジ型感光性樹脂組成物>

本発明のポジ型感光性樹脂組成物は、上記の各成分を均一に混合することによって容易 に調製することができ、通常、適当な溶剤に溶解されて溶液状態で用いられる。例えば、 アルカリ可溶性樹脂を溶剤に溶解し、この溶液に1,2-キノンジアジド化合物、架橋性 化合物、界面活性剤および必要に応じて他の成分を所定の割合で混合することにより、溶 液として感光性樹脂組成物を調製することができる。そのような溶剤としては、エチレン グリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、メチルセロソ ルプアセテート、エチルセロソルブアセテート、ジエチレングリコールモノメチルエーテ ル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコール、プロピレングリ コールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロ ピレングリコールプロピルエーテルアセテート、トルエン、キシレン、メチルエチルケト ン、シクロペンタノン、シクロヘキサノン、2-ヒドロキシプロピオン酸エチル、2-ヒ ドロキシー2ーメチルプロピオン酸エチル、エトシキ酢酸エチル、ヒドロキシ酢酸エチル 、2-ヒドロキシー3-メチルブタン酸メチル、3-メトキシプロピオン酸メチル、3-メトキシプロピオン酸エチル、3-エトキシプロピオン酸エチル、3-エトキシプロピオ ン酸メチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、乳酸エチ ル、乳酸ブチル等を用いることができる。これらの有機溶剤は単独または2種以上の組合 せで使用される。

### [0059]

さらに、プロピレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテルアセテート等の高沸点溶剤を混合して使用することができる。これらの溶剤の中でプロピレングリコールモノメチルエーテル

アセテート、乳酸エチル、乳酸ブチル、及びシクロヘキサノンがレベリング性の向上に対 して好ましい。

# [0060]

本発明のポジ型感光性樹脂組成物を溶液とした時の固形分濃度は、各成分が均一に溶解している限りは、特に限定されない。通常は加工面の容易さから、 $1\sim50$  重量%の範囲で使用するのが一般的である。また、上記のように調製されたポジ型感光性樹脂組成物溶液は、孔径が $0.5\mu$  m程度のフィルタなどを用いて濾過した後、使用に供することが好ましい。このように調製されたポジ型感光性樹脂組成物の溶液は、室温で長期間の保存安定性にも優れる。

### [0061]

本発明のポジ型感光性樹脂組成物の溶液は、ガラス基板、シリコーンウェハー、酸化膜、窒化膜などの基材上に回転塗布した後、80~130℃で30秒~600秒予備乾燥して塗膜を形成することができる。

### [0062]

上記の塗膜上に所定のパターンを有するマスクを装着し、光を照射し、アルカリ現像液で現像することにより、露光部が洗い出されて端面のシャープなレリーフパターンが得られる。この際使用される現像液はアルカリ水溶液であればどのようなものでもよく、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウムなどのアルカリ金属水酸化物の水溶液、水酸化テトラメチルアンモニウム、水酸化テトラエチルアンモニウム、コリンなどの水酸化四級アンモニウムの水溶液、エタノールアミン、プロピルアミン、エチレンジアミンなどのアミン水溶液を例として挙げることができる。

### [0063]

前記アルカリ現像液は10重量%以下の水溶液であることが一般的で、好ましくは $0.1\sim3.0$ 重量%の水溶液などが用いられる。本発明の感光性樹脂組成物はフォトレジストで一般的に使用される水酸化テトラエチルアンモニウム $0.4\sim2.38$ 重量%水溶液で膨潤などの問題なく現像することができる。さらに上記現像液にアルコール類や界面活性剤を添加して使用することもできる。これらはそれぞれ、現像液100重量部に対して、好ましくは $0.05\sim10$ 重量部の範囲で配合する。

### [0064]

現像時間は、通常  $15 \sim 180$  秒間である。また現像方法は液盛り法、ディッピング法などのいずれでもよい。現像後、流水洗浄を  $20 \sim 90$  秒間行い、圧縮空気や圧縮窒素で風乾させることによって、基板上の水分を除去し、パターン状塗膜が形成される。その後このパターン状塗膜に、高圧水銀灯などによる光を全面照射し、パターン状塗膜中に残存する 1, 2-+1ンジアジド化合物を完全に分解させる。続いて、ホットプレート、オーブンなどにより、ポストベークをすることによって、耐熱性、透明性、平坦化性、低吸水性、耐薬品性に優れ、良好なレリーフパターンを有する塗膜を得ることができる。ポストベークは、例えば温度  $140 \sim 250$  ℃で、ホットプレート上なら5~30分間、オーブン中では  $30 \sim 90$  分間処理すればよい。

#### 【実施例】

#### [0065]

以下に実施例を挙げ、本発明を更に詳しく説明するが、本発明はこれらに限定されるも のではない。

#### [0066]

<合成例1>特定共重合体(P1~P4)

特定共重合体を構成するモノマー成分として、メタクリル酸 13.5g、N-シクロへキシルマレイミド <math>35.3g、メタクリル酸ヒドロキシエチル 25.5g、メタクリル酸メチル 25.7gを使用し、ラジカル重合開始剤としてアゾビスイソブチロニトリルを使用し、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(以下、PGMEAと略す)中で、60~100で反応させることにより、以下に示す特定共重合体のPGMEA溶液を得た。

[0067]

(P1):数平均分子量 4,100 ;残留モノマー率 1.5重量% (P2):数平均分子量 9,500 ;残留モノマー率 1.6重量%

(P3):数平均分子量 4,200 ;残留モノマー率 0.5重量%(P4):数平均分子量 4,300 ;残留モノマー率 5.0重量%

[0068]

<合成例2>特定共重合体(P5)

合成例1において、PGMEAに換えて、シクロヘキサノンを使用し、合成例1と同様にして以下に示す特定共重合体のシクロヘキサノン溶液を得た。

(P5):数平均分子量 4,500 ;残留モノマー率 1.1重量%

[0069]

<合成例3>特定共重合体(P6)

合成例1において、Nーシクロヘキシルマレイミド35.3gに換えて、Nーフェニルマレイミド35.3gを使用し、合成例1と同様にして以下に示す特定共重合体のPGMEA溶液を得た。

(P6):数平均分子量 5,100 ;残留モノマー率 1.4重量%

[0070]

<合成例4>特定共重合体(P7)

合成例1において、メタクリル酸ヒドロキシエチル25.5gおよびメタクリル酸メチル25.7gに換えて、メタクリル酸ヒドロキシブチル25.5gおよびマレイン酸ジエチル25.7gを使用し、合成例1と同様にして以下に示す特定共重合体のPGMEA溶液を得た。

(P7):数平均分子量 4,100 ;残留モノマー率 1.3重量%

[0071]

<合成例5>特定共重合体(P8)

特定共重合体を構成するモノマー成分として、メタクリル酸 9.0 g、N-シクロヘキシルマレイミド 32.8 g、メタクリル酸ヒドロキシエチル 25.4 g、メタクリル酸メチル 32.8 gを使用し、合成例 1 と同様にして以下に示す特定共重合体の P G M E A 溶液を得た。

(P8):数平均分子量 3,800 ;残留モノマー率 1.6重量%

[0072]

<合成例6>共重合体(P9)

共重合体を構成するモノマー成分として、メタクリル酸13.5g、メタクリル酸ヒドロキシエチル25.5g、メタクリル酸メチル61.0gを使用し、合成例1と同様にして以下に示す共重合体のPGMEA溶液を得た。

(P9) : 数平均分子量 4, 400 ; 残留モノマー率 1. 4重量%

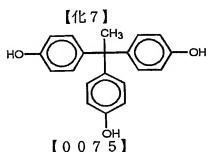
[0073]

<実施例1>

[組成物の各成分]

[アルカリ可溶性樹脂] 合成例1で得られた特定共重合体(P1)

[0074]



[架橋性化合物] 4官能のシクロヘキセンオキサイド構造を有する下記式(5)の化合物。

【0076】 【化8】 (1) (1) (5)

### [0077]

# 「ポジ型感光性樹脂組成物の調製]

樹脂濃度 2.7% の P G M E A 溶液に調製したアルカリ可溶性樹脂溶液 8.2.1 g に、 1 , 2-+1 ンジアジド化合物 4.2 g、架橋性化合物 4.9 g、さらに界面活性剤として、フッ素系の界面活性剤であるメガファック R-30 (大日本インキ化学製) 0.02 g、密着助剤として  $\gamma$  - メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン 1.0 g を添加後、室温で 1 時間攪拌し、、本発明のポジ型感光性樹脂組成物である組成物溶液(1)を調製した。この組成物溶液(1)の粘度は 2.1.0 m P a · s であった。また、組成物溶液(1)を室温で 3 ヶ月放置した後でも粘度の変化は見られなかった。

### [0078]

### [硬化膜の作成]

### [0079]

#### [硬化膜のプロセス耐性評価]

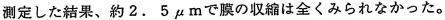
耐熱性:前記と同様に作製した硬化膜を基板から削り取り、TG-DTA測定により耐熱性の評価をした。その結果、熱分解開始温度は270℃、5%重量減少温度は330℃であった。また、ガラス転移温度は200℃以上であった。

### [0080]

耐溶剤性:酸化シリコン付ガラス基板の代わりに石英基板を用い、前記と同様に2.5  $\mu$  mの硬化膜を得た。この硬化膜をモノエタノールアミン、N-メチルピロリドン、 $\gamma-$ ブチルラクトン、ブチルセルソルブ、10%HC1の各溶液中に、60%、20分間浸し、各溶液から取り出した硬化膜を<math>180%、10分間加熱した。得られた硬化膜の透明性を分光光度計を用いて<math>200-800nmの波長で測定したところ、400nmでの透過率は95%で溶剤処理前からの低下はみられなかった。また、溶剤処理後の膜厚は約2.5  $\mu$  mで膜減りは全く見られなかった。

#### [0081]

長時間焼成耐性:酸化シリコン付ガラス基板の代わりに石英基板を用い、前記と同様に 2.5 μ mの硬化膜を得た。この硬化膜をさらに230℃で90分間加熱した後に膜厚を



### [0082]

# 「硬化膜の透明性評価]

酸化シリコン付ガラス基板の代わりに石英基板を用い、前記と同様に2.  $5\mu$  m硬化膜を得た。この硬化膜を分光光度計を用いて200-800 n mの波長で測定したところ、400 n mでの透過率は95%であった。さらにこの硬化膜を230%で90分間加熱した後に、分光光度計を用いて200-800 n mの波長で測定したところ、400 n mでの透過率は94%であった。組成物溶液を室温で2ヶ月保存後、同様の評価を行った結果、透明性の低下は見られなかった。

### [0083]

### 「硬化膜の信頼性評価」

前記と同様に、酸化シリコン付ガラス基板上に作製した硬化膜を基板から削り取り、この粉末  $25\,\mathrm{mg}$  をネマチック液晶(メルク社製  $2\,\mathrm{LI}-2\,2\,9\,3$ )1.  $5\,\mathrm{g}$  に添加した。この混合物を  $1\,0\,0\,\mathrm{C}$ 、  $2\,4$  時間加熱して得られた混合物を 0.  $4\,5\,\mu\,\mathrm{m}$ のフィルターでろ過することにより、信頼性試験サンプル液晶を得た。一方、硬化膜を加えずに  $1\,0\,0\,\mathrm{C}$ 、  $2\,4$  時間加熱した液晶を比較液晶とした。

### [0084]

上記2種類の液晶を用いて液晶セルを作製し、電圧保持率の比較を行った。その結果、 信頼性試験サンプル液晶の電圧保持率は、23℃で98%、80℃で89%、比較液晶の 電圧保持率は、23℃で98%、80℃で89%であり、同等の値を示した。

なお、液晶セルは、透明電極付き基板 2 枚を一組とし、一方の基板の電極面に 6  $\mu$  mのスペーサーを散布し、電極面を内側にして 2 枚を張り合わせた後、液晶を注入して作製した。また、電圧保持率の測定は、 $\pm 4$  V の電圧を、パルス幅 6 4  $\mu$  s 、周波数 6 4 H z の条件で印加し行った。

# [0085]

#### [感光特性の評価]

#### [0086]

解像度:パターン解像度は、ライン/スペースで  $3~\mu$  mまでパターン剥離なく形成された。その後、全面に 4~2~0~n mにおける光強度が 1~5~m W/c m² の紫外線を 2~0 秒間( 3~0~0~m J/c m²) 照射し、 2~3~0 ℃で 3~0 分間のポストベークを行い、 膜厚  $2~.5~\mu$  mのパターンが得られた。

### [0087]

感度:上記のパターン形成において、現像前の紫外線の照射量を10mJ/cm² ずつ変えて紫外線照射処理を行い、露光部が現像液に完全に溶解するために必要な最小の紫外線照射量を測定しところ、40mJ/cm² の照射で完全に溶解した。組成物溶液を室温で2ヶ月保存後、同様の評価を行った結果、感度の低下は見られなかった。

### [0088]

#### <実施例2>

実施例1において、1,2ーキノンジアジド化合物として、下記構造で示されるトリスフェノール1molと、1,2ーナフトキノン-2ージアジド-5ースルホニルクロライド2.0molとの縮合反応によって合成される感光剤を使用した以外は、実施例1と同様にポジ型感光性樹脂組成物を調製し、本発明のポジ型感光性樹脂組成物である組成物溶液(2)を得た。

#### [0090]

この組成物溶液(2)を用いて、実施例1と同様に評価を行った。

#### [0091]

「硬化膜のプロセス耐性]

耐熱性:熱分解開始温度は270℃、5%重量減少温度は330℃であった。また、ガラス転移温度は200℃以上であった。

耐溶剤性:400nmでの透過率は96%で溶剤処理前からの低下はみられなかった。また、溶剤処理後の膜厚は約 $2.5\mum$ で膜べりは全く見られなかった。

長時間焼成耐性:膜の収縮は全くみられなかった。

### [0092]

[硬化膜の透明性]

400nmでの透過率は96%であった。さらにこの硬化膜を230℃で90分間加熱した後に、400nmでの透過率は95%であった。組成物溶液を室温で2ヶ月保存後、同様の評価を行った結果、透明性の低下は見られなかった。

### [0093]

「硬化膜の信頼性]

信頼性試験サンプル液晶の電圧保持率は、23℃で98%、80℃で88%であり、比 較液晶の電圧保持率と同等の値を示した。

#### [0094]

[感光特性]

解像度:パターン解像度は、ライン/スペースで  $3~\mu$  mまでパターン剥離なく形成された。その後、全面に 4~2~0~n mにおける光強度が 1~5~mW/c m  $^2$  の紫外線を 2~0 秒間( 3~0~0 m J/c m  $^2$ ) 照射し、 2~3~0  $\mathbb C$  で 3~0 分間のポストベークを行い、 膜厚  $2~.5~\mu$  mのパターンが得られた。

感度:露光部が現像液に完全に溶解するために必要な最小の紫外線照射量を測定しところ、 $50\,\mathrm{m}\,\mathrm{J}/\mathrm{c}\,\mathrm{m}^2$ の照射で完全に溶解した。組成物溶液を室温で $2\,\mathrm{r}$ 月保存後、同様の評価を行った結果、感度の低下は見られなかった。

### [0095]

<実施例3>

実施例1において、アルカリ可溶性樹脂として、合成例1で得られた特定共重合体(P2)を使用した以外は、実施例1と同様にポジ型感光性樹脂組成物を調製し、本発明のポジ型感光性樹脂組成物である組成物溶液(3)を得た。この組成物溶液(3)を用いて、実施例1と同様に評価を行った。

### [0096]

「硬化膜のプロセス耐性]

耐熱性:熱分解開始温度は270℃、5%重量減少温度は330℃であった。また、ガラス転移温度は200℃以上であった。

耐溶剤性:400nmでの透過率は96%で溶剤処理前からの低下はみられなかった。また、溶剤処理後の膜厚は約 $2.5\mu$ mで膜べりは全く見られなかった。

長時間焼成耐性:膜の収縮は全くみられなかった。

### [0097]

# [硬化膜の透明性]

400 n m での透過率は 96 % であった。さらにこの硬化膜を 230 ℃ で 90 分間加熱した後に、 400 n m での透過率は 95 % であった。組成物溶液を室温で 2 ヶ月保存後、同様の評価を行った結果、透明性の低下は見られなかった。

### [0098]

# [硬化膜の信頼性]

信頼性試験サンプル液晶の電圧保持率は、23℃で98%、80℃で88%であり、比較液晶の電圧保持率と同等の値を示した。

#### [0099]

### [感光特性]

解像度: パターン解像度は、ライン/スペースで  $3~\mu$  mまでパターン剥離なく形成された。その後、全面に 4~2~0~n mにおける光強度が 1~5~mW/c m² の紫外線を 2~0秒間( 3~0~0~mJ/c m²) 照射し、 2~3~0℃で 3~0分間のポストベークを行い、膜厚  $2~.5~\mu$  mのパターンが得られた。

感度:露光部が現像液に完全に溶解するために必要な最小の紫外線照射量を測定しところ、 $4.5\,\mathrm{m}\,\mathrm{J}/\mathrm{c}\,\mathrm{m}^2$ の照射で完全に溶解した。組成物溶液を室温で $2\,\mathrm{r}$ 月保存後、同様の評価を行った結果、感度の低下は見られなかった。

### [0100]

### <実施例4>

実施例1において、アルカリ可溶性樹脂として、合成例1で得られた特定共重合体(P3)を使用した以外は、実施例1と同様にポジ型感光性樹脂組成物を調製し、本発明のポジ型感光性樹脂組成物である組成物溶液(4)を得た。この組成物溶液(4)を用いて、実施例1と同様に評価を行った。

### [0101]

### [硬化膜のプロセス耐性]

耐熱性:熱分解開始温度は270℃、5%重量減少温度は330℃であった。また、ガラス転移温度は200℃以上であった。

耐溶剤性:400nmでの透過率は96%で溶剤処理前からの低下はみられなかった。また、溶剤処理後の膜厚は約 $2.5\mum$ で膜べりは全く見られなかった。

長時間焼成耐性:膜の収縮は全くみられなかった。

### [0102]

# [硬化膜の透明性]

 $400 \, n \, m$ での透過率は96%であった。さらにこの硬化膜を230%で90分間加熱した後に、 $400 \, n \, m$ での透過率は96%であった。組成物溶液を室温で $2 \, r \, F$ 保存後、同様の評価を行った結果、透明性の低下は見られなかった。

### [0103]

### [硬化膜の信頼性]

信頼性試験サンプル液晶の電圧保持率は、23℃で98%、80℃で89%であり、比較液晶の電圧保持率と同等の値を示した。

### [0104]

#### 「感光特性」

解像度:パターン解像度は、ライン/スペースで $3\mu$ mまでパターン剥離なく形成された。その後、全面に420nmにおける光強度が15mW/cm²の紫外線を20秒間(300mJ/cm²)照射し、230℃で30分間のポストベークを行い、膜厚 $2.5\mu$ mのパターンが得られた。

感度:露光部が現像液に完全に溶解するために必要な最小の紫外線照射量を測定しとこ

ろ、 $40\,\mathrm{m}\,\mathrm{J}/\mathrm{c}\,\mathrm{m}^2$ の照射で完全に溶解した。組成物溶液を室温で $2\,\mathrm{r}$ 月保存後、同様の評価を行った結果、感度の低下は見られなかった。

### [0105]

<実施例5>

実施例1において、アルカリ可溶性樹脂として、合成例1で得られた特定共重合体(P3)を使用し、架橋性化合物の添加量を3.4gにした以外は、実施例1と同様にポジ型感光性樹脂組成物を調製し、本発明のポジ型感光性樹脂組成物である組成物溶液(5)を得た。この組成物溶液(5)を用いて、実施例1と同様に評価を行った。

### [0106]

「硬化膜のプロセス耐性]

耐熱性:熱分解開始温度は270  $\mathbb{C}$ 、5% 重量減少温度は330  $\mathbb{C}$  であった。また、ガラス転移温度は200  $\mathbb{C}$ 以上であった。

耐溶剤性:400nmでの透過率は96%で溶剤処理前からの低下はみられなかった。また、溶剤処理後の膜厚は約 $2.5\mu$ mで膜べりは全く見られなかった。

長時間焼成耐性:膜の収縮は全くみられなかった。

#### [0107]

[硬化膜の透明性]

400 n mでの透過率は96%であった。さらにこの硬化膜を230℃で90分間加熱した後に、400 n mでの透過率は95%であった。組成物溶液を室温で2ヶ月保存後、同様の評価を行った結果、透明性の低下は見られなかった。

### [0108]

[硬化膜の信頼性]

信頼性試験サンプル液晶の電圧保持率は、23℃で98%、80℃で89%であり、比較液晶の電圧保持率と同等の値を示した。

#### [0109]

[感光特性]

解像度:パターン解像度は、ライン/スペースで  $3 \mu$  mまでパターン剥離なく形成された。その後、全面に 420 n mにおける光強度が 15 mW/c m² の紫外線を 20 秒間( 300 m J/c m²) 照射し、 230 ℃で 30 分間のポストベークを行い、膜厚  $2.5 \mu$  mのパターンが得られた。

感度:露光部が現像液に完全に溶解するために必要な最小の紫外線照射量を測定しところ、 $40\,\mathrm{m\,J/c\,m^2}$ の照射で完全に溶解した。組成物溶液を室温で $2\,\mathrm{fr}$ 月保存後、同様の評価を行った結果、感度の低下は見られなかった。

#### [0110]

<実施例6>

実施例1において、アルカリ可溶性樹脂として、合成例1で得られた特定共重合体(P4)を使用し、架橋性化合物の添加量を3.4gにした以外は、実施例1と同様にポジ型感光性樹脂組成物を調製し、本発明のポジ型感光性樹脂組成物である組成物溶液(6)を得た。この組成物溶液(6)を用いて、実施例1と同様に評価を行った。

### [0111]

「硬化膜のプロセス耐性]

耐熱性:熱分解開始温度は270℃、5%重量減少温度は330℃であった。また、ガラス転移温度は200℃以上であった。

耐溶剤性:400nmでの透過率は95%で溶剤処理前からの低下はみられなかった。また、溶剤処理後の膜厚は約 $2.5\mum$ で膜べりは全く見られなかった。

長時間焼成耐性:膜の収縮は全くみられなかった。

#### [0112]

[硬化膜の透明性]

400 n m での透過率は95%であった。さらにこの硬化膜を230℃で90分間加熱した後に、400 n m での透過率は94%であった。組成物溶液を室温で2ヶ月保存後、

同様の評価を行った結果、透明性の低下は見られなかった。

# [0113]

# [硬化膜の信頼性]

信頼性試験サンプル液晶の電圧保持率は、23℃で97%、80℃で84%であり、比較液晶の電圧保持率とほぼ同等の値を示した。

### [0114]

# [感光特性]

解像度:パターン解像度は、ライン/スペースで $3\mu$ mまでパターン剥離なく形成された。その後、全面に420nmにおける光強度が15mW/cm²の紫外線を20秒間(300mJ/cm²)照射し、230℃で30分間のポストベークを行い、膜厚 $2.5\mu$ mのパターンが得られた。

感度:露光部が現像液に完全に溶解するために必要な最小の紫外線照射量を測定しところ、 $40\,\mathrm{m}\,\mathrm{J}/\mathrm{c}\,\mathrm{m}^2$ の照射で完全に溶解した。組成物溶液を室温で $2\,\mathrm{r}$ 月保存後、同様の評価を行った結果、感度の低下は見られなかった。

### [0115]

# <実施例7>

実施例1において、アルカリ可溶性樹脂として、合成例2で得られた特定共重合体(P5)を使用し、これを樹脂濃度27%のシクロヘキサノン溶液に調製したアルカリ可溶性樹脂溶液を使用した以外は実施例1と同様にポジ型感光性樹脂組成物を調製し、本発明のポジ型感光性樹脂組成物である組成物溶液(7)を得た。この組成物溶液(7)を用いて、実施例1と同様に評価を行った。

# [0116]

# [硬化膜のプロセス耐性]

耐熱性:熱分解開始温度は270℃、5%重量減少温度は330℃であった。また、ガラス転移温度は200℃以上であった。

耐溶剤性:400nmでの透過率は96%で溶剤処理前からの低下はみられなかった。また、溶剤処理後の膜厚は約 $2.5\mum$ で膜べりは全く見られなかった。

長時間焼成耐性:膜の収縮は全くみられなかった。

#### [0117]

# [硬化膜の透明性]

400nmでの透過率は96%であった。さらにこの硬化膜を230℃で90分間加熱した後に、400nmでの透過率は95%であった。組成物溶液を室温で2ヶ月保存後、同様の評価を行った結果、透明性の低下は見られなかった。

### [0118]

### [硬化膜の信頼性]

信頼性試験サンプル液晶の電圧保持率は、23℃で98%、80℃で89%であり、比 較液晶の電圧保持率と同等の値を示した。

### [0119]

### [感光特性]

解像度:パターン解像度は、ライン/スペースで  $3~\mu$  mまでパターン剥離なく形成された。その後、全面に 4~2~0~n mにおける光強度が 1~5~m W/c m² の紫外線を 2~0 秒間( 3~0~0~m J/c m²) 照射し、 2~3~0 ℃で 3~0 分間のポストベークを行い、膜厚  $2~.5~\mu$  mのパターンが得られた。

感度:露光部が現像液に完全に溶解するために必要な最小の紫外線照射量を測定しところ、 $40\,\mathrm{m}\,\mathrm{J}/\mathrm{c}\,\mathrm{m}^2$ の照射で完全に溶解した。組成物溶液を室温で $2\,\mathrm{r}$ 月保存後、同様の評価を行った結果、感度の低下は見られなかった。

### [0120]

# <実施例8>

実施例1において、アルカリ可溶性樹脂として、合成例3で得られた特定共重合体(P6)を使用した以外は、実施例1と同様にポジ型感光性樹脂組成物を調製し、本発明のポ

ジ型感光性樹脂組成物である組成物溶液(8)を得た。この組成物溶液(8)を用いて、 実施例1と同様に評価を行った。

### [0121]

[硬化膜のプロセス耐性]

耐熱性:熱分解開始温度は270℃、5%重量減少温度は335℃であった。また、ガラス転移温度は200℃以上であった。

耐溶剤性:400nmでの透過率は95%で溶剤処理前からの低下はみられなかった。また、溶剤処理後の膜厚は約 $2.5\mum$ で膜べりは全く見られなかった。

長時間焼成耐性:膜の収縮は全くみられなかった。

### [0122]

「硬化膜の透明性]

400 nmでの透過率は95%であった。さらにこの硬化膜を230℃で90分間加熱した後に、400 nmでの透過率は94%であった。組成物溶液を室温で2ヶ月保存後、同様の評価を行った結果、透明性の低下は見られなかった。

### [0123]

[硬化膜の信頼性]

信頼性試験サンプル液晶の電圧保持率は、23℃で97%、80℃で88%であり、比較液晶の電圧保持率と同等の値を示した。

### [0124]

[感光特性]

解像度:パターン解像度は、ライン/スペースで $3\mu$ mまでパターン剥離なく形成された。その後、全面に420nmにおける光強度が15mW/cm²の紫外線を20秒間(300mJ/cm²)照射し、230Cで30分間のポストベークを行い、膜厚 $2.5\mu$ mのパターンが得られた。

感度:露光部が現像液に完全に溶解するために必要な最小の紫外線照射量を測定しところ、 $40\,\mathrm{m}\,\mathrm{J}/\mathrm{c}\,\mathrm{m}^2$ の照射で完全に溶解した。組成物溶液を室温で $2\,\mathrm{r}$ 月保存後、同様の評価を行った結果、感度の低下は見られなかった。

### [0125]

<実施例9>

実施例1において、アルカリ可溶性樹脂として、合成例4で得られた特定共重合体(P7)を使用した以外は、実施例1と同様にポジ型感光性樹脂組成物を調製し、本発明のポジ型感光性樹脂組成物である組成物溶液(9)を得た。この組成物溶液(9)を用いて、実施例1と同様に評価を行った。

# [0126]

「硬化膜のプロセス耐性」

耐熱性:熱分解開始温度は265  $\mathbb{C}$ 、5% 重量減少温度は325  $\mathbb{C}$  であった。また、ガラス転移温度は200  $\mathbb{C}$ 以上であった。

耐溶剤性:400nmでの透過率は95%で溶剤処理前からの低下はみられなかった。また、溶剤処理後の膜厚は約 $2.5\mum$ で膜べりは全く見られなかった。

長時間焼成耐性:膜の収縮は全くみられなかった。

#### [0127]

[硬化膜の透明性]

400 n m での透過率は95%であった。さらにこの硬化膜を230℃で90分間加熱した後に、400 n m での透過率は94%であった。組成物溶液を室温で2ヶ月保存後、同様の評価を行った結果、透明性の低下は見られなかった。

# [0128]

「硬化膜の信頼性]

信頼性試験サンプル液晶の電圧保持率は、23℃で98%、80℃で88%であり、比較液晶の電圧保持率と同等の値を示した。

[0129]

# [感光特性]

解像度:パターン解像度は、ライン/スペースで  $3~\mu$  mまでパターン剥離なく形成された。その後、全面に 4~2~0~n mにおける光強度が 1~5~mW/c m  $^2$  の紫外線を 2~0 秒間( 3~0~0~m J/c m  $^2$ ) 照射し、 2~3~0  $\mathbb C$  で 3~0 分間のポストベークを行い、膜厚  $2~.5~\mu$  mのパターンが得られた。

感度:露光部が現像液に完全に溶解するために必要な最小の紫外線照射量を測定しところ、 $4.5\,\mathrm{m}$  J / c  $\mathrm{m}^2$  の照射で完全に溶解した。組成物溶液を室温で $2\,\mathrm{r}$  月保存後、同様の評価を行った結果、感度の低下は見られなかった。

# [0130]

# <実施例10>

実施例1において、アルカリ可溶性樹脂として、合成例5で得られた特定共重合体(P8)を使用した以外は、実施例1と同様にポジ型感光性樹脂組成物を調製し、本発明のポジ型感光性樹脂組成物である組成物溶液(10)を得た。この組成物溶液(10)を用いて、実施例1と同様に評価を行った。

# [0131]

# [硬化膜のプロセス耐性]

耐熱性:熱分解開始温度は270  $\mathbb{C}$ 、5% 重量減少温度は310  $\mathbb{C}$ であった。また、ガラス転移温度は200  $\mathbb{C}$ 以上であった。

耐溶剤性:400nmでの透過率は95%で溶剤処理前からの低下はみられなかった。また、溶剤処理後の膜厚は約 $2.5\mum$ で膜べりは全く見られなかった。

長時間焼成耐性:膜の収縮は全くみられなかった。

### [0 1 3 2]

# 「硬化膜の透明性」

 $400\,\mathrm{nm}$ での透過率は95%であった。さらにこの硬化膜を230%で90分間加熱した後に、 $400\,\mathrm{nm}$ での透過率は94%であった。組成物溶液を室温で2ヶ月保存後、同様の評価を行った結果、透明性の低下は見られなかった。

#### [0133]

# [硬化膜の信頼性]

信頼性試験サンプル液晶の電圧保持率は、23℃で98%、80℃で88%であり、比較液晶の電圧保持率と同等の値を示した。

### [0134]

#### 「感光特性」

解像度:パターン解像度は、ライン/スペースで $3\mu$  mまでパターン剥離なく形成された。その後、全面に420 n mにおける光強度が15 mW/c m² の紫外線を20 秒間(300 m J/c m²) 照射し、230 Cで30 分間のポストベークを行い、膜厚 $2.5\mu$  mのパターンが得られた。

感度:露光部が現像液に完全に溶解するために必要な最小の紫外線照射量を測定しところ、 $45\,\mathrm{m\,J/c\,m^2}$ の照射で完全に溶解した。組成物溶液を室温で $2\,\mathrm{r}$ 月保存後、同様の評価を行った結果、感度の低下は見られなかった。

#### [0135]

#### <比較例1>

実施例1において、アルカリ可溶性樹脂として、合成例6で得られた共重合体(P9)を使用した以外は、実施例1と同様にポジ型感光性樹脂組成物を調製し、ポジ型感光性樹脂組成物である組成物溶液(9)を得た。この組成物溶液(9)を用いて、実施例1と同様に評価を行った。

# [0136]

その結果、硬化膜のプロセス耐性評価において、5%重量減少温度は290℃であり、耐熱性に劣るものであった。

### [0137]

### <比較例2>

実施例1において、アルカリ可溶性樹脂として、合成例1で得られた特定共重合体(P4)を使用し、架橋性化合物の添加量を1.0gにした以外は、実施例1と同様にポジ型感光性樹脂組成物を調製し、ポジ型感光性樹脂組成物である組成物溶液(10)を得た。この組成物溶液(10)を用いて、実施例1と同様に評価を行った。

### [0138]

その結果、硬化膜のプロセス耐性評価において、溶剤処理後の膜に透明化率の低下と、膜厚の減少がみられ、特にモノエタノールアミンを用いた場合は、400 n m での透過率が 95% から 89% に、膜厚が  $2.5\mu$  m から  $2.3\mu$  m に変化した。また、長時間焼成耐性評価では、230 で 90 分間加熱した結果、膜厚が  $2.5\mu$  m から  $2.2\mu$  m に変化し、膜の収縮が見られた。さらには、信頼性評価において、信頼性試験サンプル液晶の電圧保持率は、23 で 85%、80 で 60% であり、比較液晶よりも大幅に低い値を示した。

### [0139]

#### <比較例3>

実施例1において、1,2ーキノンジアジド化合物として、下記構造で示されるトリスフェノール1molと、1,2ーナフトキノンー2ージアジドー5ースルホニルクロライド3.0molとの縮合反応によって合成される感光剤を使用した以外は実施例1と同様に調製し、ポジ型感光性樹脂組成物である組成物溶液(11)を得た。

# [0140]

【化10】

この組成物溶液(11)を用いて、実施例1と同様に評価を行った。

#### [0142]

### [0143]

#### <比較例4>

実施例1において、架橋性化合物として、ヘキサメトキシメチロールメラミンを使用した以外は実施例1と同様に調製し、ポジ型感光性樹脂組成物である組成物溶液(12)を 得た。この組成物溶液(12)を用いて、実施例1と同様に評価を行った。

### [0144]

その結果、硬化膜のプロセス耐性評価において、5%重量減少温度は290%と耐熱性に劣るものであった。また、透明性の評価において、400nmでの透過率は88%と低い値を示し、さらにこの硬化膜を230%で90分間加熱した後に、分光光度計を用いて <math>200-800nmの波長で測定したところ、400nmでの透過率は79%であった。【産業上の利用可能性】

# [0145]

本発明のポジ型感光性樹脂組成物は、パターン形成が必要な硬化膜でかつ、平坦性、耐熱性、耐溶剤性、長時間焼成耐性、高透明性、等の諸特性が必要な硬化膜を作製するのに利用することができる。

#### [0146]

本発明のポジ型感光性樹脂組成物は、薄膜トランジスタ(TFT)型液晶表示素子、有機EL素子等のディスプレイにおける、保護膜、平坦化膜、絶縁膜等を形成する材料とし

て好適であり、特に、TFTの層間絶縁膜、カラーフィルターの保護膜、平坦化膜、反射型ディスプレイの反射膜下の凹凸膜、マイクロレンズ材料、有機EL素子の絶縁膜等を形成する材料として好適である。



【要約】

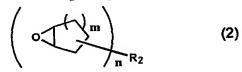
【課題】 耐熱性、耐溶剤性、長時間焼成耐性等のプロセス耐性、および透明性に優れる硬化膜を作製することができ、かつ、解像度、感度等の感光特性に優れ、保存安定性が高くプロセスマージンの広いポジ型感光性樹脂組成物、さらには液晶表示素子用途として、電気特性の悪化を招くことのない信頼性の高いポジ型感光性樹脂組成物を提供する。

【解決手段】 不飽和カルボン酸誘導体とNー置換マレイミドとを必須とする共重合体であり、数平均分子量が2,000~20,000のアルカリ可溶性樹脂と、一般式(1)

(式中、Dはそれぞれ独立に水素原子または1, 2-キノンジアジド基を有する有機基であり、 $R_1$  は4 価の有機基である。ただし、Dの少なくとも1つは、1, 2-キノンジアジド基を有する有機基である。)

で示される 1, 2 ーキノンジアジド化合物と、アルカリ可溶性樹脂に対して  $5\sim 5$  0 重量 部の一般式 (2)

### 【化2】



(式中、nは $2\sim10$ の整数、mは $0\sim4$ の整数を示し、 $R_2$ はn価の有機基を表す)で表される架橋性化合物とを含有することを特徴とするポジ型感光性樹脂組成物。

特願2003-280625

出願人履歴情報

識別番号

[000003986]

1. 変更年月日

1990年 8月29日

[変更理由]

新規登録

住所

東京都千代田区神田錦町3丁目7番地1

氏 名 日産化学工業株式会社